

## A & Dグループの半導体検査・測定装置メーカー、 株式会社ホロンの新本社工場が完成いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）グループの半導体検査・測定装置メーカー、株式会社ホロン（本社：東京都立川市、代表取締役社長：張 皓）の新本社工場が完成いたしました。

### 【1. 新本社工場建設の目的】

お客様からの需要に応えるため、生産体制の拡大と開発・製造環境の充実をはかることを第一の目的としています。特にクリーンルームを従来の3倍のスペースに拡充し、従来の製造能力は年間10基ほどでしたが、これを年間20基以上に引き上げ、次世代機の開発スペースや装置のプレゼンテーションエリアも併設しました。

また、社員が働く環境を改善し、優秀な人材を獲得するために、駅（西武拝島線 武蔵砂川駅）の近隣に建設いたしました。



2021年8月2日 開所式



ホロン新本社工場

## 【2. ホロンの主な製品】

ホロンは独自の電子ビーム技術を活かして、半導体デバイスの製造に必要な回路図の微細な回路パターンの寸法測定装置を製造・販売しています。現在、中長期に渡りお客様の先端需要に応えるためにエー・アンド・デイとシナジー効果を発揮し次世代機の開発を行っています。

### <主力製品情報>

#### (1) フォトマスク用 CD-SEM 「ZX」

- ホロンがフォトマスク市場で長年培ってきた独自の高分解能技術、チャージ対策技術をさらに進化させて、sub-10nm 最先端デバイス用マスク向けに開発した装置
- ナノパターンの高速・高精度計測が可能
- 収差補正技術をさらに改良し、高 SNR イメージを取得
- 低真空技術によるチャージフリーSEM 画像を取得、高精度計測が可能
- 多彩なアプリケーション（多点計測・輪郭抽出・2D 測定・欠陥レビュー・3D 表示）



#### (2) 欠陥レビューSEM 「LEXa-10」

- フォトマスク用 CD-SEM で定評のある低真空技術の採用により、チャージ抑制を行いながらナノの世界を観察・分析する欠陥レビュー装置
- 低真空技術によるフォトマスク（絶縁物）の全面観察および元素分析
- 低加速電圧による高分解能、低ダメージ分析
- 光学式欠陥検査装置とのリンク機能
- 自動欠陥レビューナビゲーション（ADR）機能



ホロンは、用途に応じて各種の半導体検査・測定装置を製作し、お客様のニーズにお応えしています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.holon-ltd.co.jp/>

---

### <会社概要>

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ  
本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  
代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
設立 : 1977 年 5 月  
資本金 : 6,388 百万円  
市場情報 : 東証 1 部 7745  
事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

会社名 : 株式会社ホロン  
新本社工場 : 〒190-0032 東京都立川市上砂町 5-40-1  
代表者 : 代表取締役社長 張 皓  
設立 : 1985 年 5 月  
市場情報 : JASDAQ スタンダード 7748  
資本金 : 1,764 百万円 (2021 年 3 月末現在)  
事業内容 : 半導体回路の寸法測定および検査装置の開発、製造、販売、保守サービス

### <本件に関するお問い合わせ先>

株式会社エー・アンド・デイ  
TEL : 03-5391-6135 販売促進部 高妻 淳史

株式会社ホロン  
TEL : 042-537-7990 総務部 飯嶋 優樹